

INFORMACION TECNICA



SIDASA

PROCESOS PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



UNITS COATING GROUP

UNIPAS 219 AC 1

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

- Estado físico Líquido transparente pajizo
- pH 10 g/l $2,2 \pm 0,5$
- Composición Mezcla de acido fluorocomplejo y compuestos orgánicos en solución acuosa.

DESCRIPCIÓN

UNIPAS 219 AC 1 es un pasivador metalorgánico exento de cromo, particularmente indicado para el pasivado de sustrato en continuo previo al sucesivo tratamiento con barniz, que favorece la adhesión del film del mismo y aumenta la propiedad anticorrosiva del material. Es un producto que se utiliza en spray o por inmersión, en solución acuosa.

CONDICIONES DE EMPLEO

- Concentración de utilización 10 - 30 g/l
- Temperatura de trabajo $\leq 60^{\circ}\text{C}$
- Tiempo de tratamiento 1" -10"
- Presión de spray 0,5 -2,0 bar
- Conductividad del baño a 20°C 500 - 3000 $\mu\text{S/cm}$
- pH de trabajo a 20°C 2,5 - 5,0

La asistencia técnica de SIDASA en el momento de formulación de la instalación, suministrará de todos modos, las indicaciones optimas de aplicación del producto en función de las características de la instalación al igual que del tipo de material a tratar.

ALIMENTACIÓN DEL BAÑO

Añadir **UNIPAS 219 AC 1** a razón de 1,1 kg por cada punto consumido respecto al valor inicial y por cada 1.000 l. de solución.

Se debe verificar que el valor de pH del baño se mantenga dentro del límite predefinido, en el caso de que fuese necesario aumentar el valor, usar el ADDITIVO 210 (indicativamente, a razón de alrededor de 100 g por 1.000 litros de baño para un aumento de 0,1 unidad-pH). En el caso inverso, que fuera necesario disminuir el pH, añadir **UNIPASS 219 AC 1** indicativamente a razón de aproximadamente 70 g por 1.000 litros de baño y para una reducción de 0,1 unidad-pH. Proceder con la adición en modo lento y con agitación notable.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Todo el material en contacto con **UNIPAS 219 AC 1**, mecanismos de calentamiento y de spray de los baños, deben estar contruidos en material resistente a los ácidos.

MÉTODO DE ANÁLISIS

PRINCIPIO

UNIPAS 219 AC 1 viene controlado mediante determinación periódica de su concentración través de una valoración complexométrica de la solución en examen, con una solución de EDTA a concentración dada, en presencia de una solución tampón hasta el viraje de un indicador específico.

REACTIVOS

- EDTA 0,01M
 - Solución tampón (250 g/l de hexametilentetramina + 60 g/l de ácido acético concentrado).
 - Indicador Naranja Xilenol.
 - Zinc sulfato (ZnSO₄ 0,01 M).
 - Fluoruro de potasio (KF.2H₂O) solución al 25%.
-

EJECUCION

- ▶ Coger 10 ml de baño mediante una pipeta tarada, verterlo en un erlenmeyer, diluirlo con agua destilada y agregar 20 ml de solución de EDTA 0,01M.
- ▶ Llevar a ebullición, agregar 25 ml de solución tampón caliente y mantener en ebullición al menos 3 minutos. Enfriar a temperatura ambiente, agregar con espátula indicador Naranja-Xilenol y valorar con zinc sulfato 0,01M utilizando una bureta hasta variación de la coloración de la solución de amarillo a rosa persistente. Agregar a la solución 10 ml de solución de potasio fluoruro y después una espera de pocos minutos, valorar de nuevo con zinc sulfato 0,01M hasta nueva variación del color de amarillo a rosa persistente.
- ▶ 1 ml de zinc sulfato 0,01M consumido para la segunda valoración da 1 punto de **UNIPAS 129 AC 1**.
- ▶ Un baño nuevo, preparado con 10 g/l, tiene una puntuación igual o aproximadamente de 3, mientras uno preparado con 30 g/l tiene una puntuación igual o aproximadamente de 9,5.

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.